

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 2 部門第 3 区分
 【発行日】平成 19 年 7 月 19 日 (2007.7.19)

【公表番号】特表 2007-501716 (P2007-501716A)
 【公表日】平成 19 年 2 月 1 日 (2007.2.1)
 【年通号数】公開・登録公報 2007-004
 【出願番号】特願 2006-522555 (P2006-522555)
 【国際特許分類】

B 2 4 D 11/00 (2006.01)

H 0 1 L 21/304 (2006.01)

【F I】

B 2 4 D 11/00 B

H 0 1 L 21/304 6 2 2 M

H 0 1 L 21/304 6 2 1 C

H 0 1 L 21/304 6 2 2 C

【手続補正書】
 【提出日】平成 19 年 5 月 31 日 (2007.5.31)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】全文
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項 1】

- a) 砥粒表面および対向する表面を含む三次元固定砥粒物品と、
- b) 前記固定砥粒物品の前記砥粒表面に隣接する第 1 の表面を含む基板と、
- c) 前記固定砥粒物品の前記対向する表面が隣接する支持アセンブリと、

を含み、

垂直力が前記基板、前記固定砥粒物品、および前記基板の前記第 1 の表面と前記固定砥粒物品の前記砥粒表面との間に接触圧力を形成する前記支持アセンブリに適用されると、前記固定砥粒物品の前記砥粒表面で高侵食力の領域と、前記固定砥粒物品の前記砥粒表面で低侵食力の領域とを形成するように前記支持アセンブリは選択され、相対運動が前記基板の前記第 1 の表面と前記固定砥粒物品の前記砥粒表面との間に生じ、

少なくとも高侵食力は前記固定砥粒物品を活性化するのに十分なものであり、前記低侵食力は前記高侵食力より小さい、三次元固定砥粒物品のインサイチュ活性化のための装置。

【請求項 2】

前記支持アセンブリが、プラテン、弾性層および剛性層、並びに

- a) 前記プラテンと前記弾性層、
- b) 前記弾性層と前記剛性層、および
- c) 前記剛性層と前記固定砥粒物品

のうち少なくとも 1 つとの間に介在された少なくとも 1 つのスペーサを含む、請求項 1 に記載の装置。

【請求項 3】

前記支持アセンブリが、プラテン、弾性層および剛性層、並びに前記プラテンと前記固定砥粒物品の間に配置された 1 以上の任意の層を含み、前記プラテン、弾性層および剛性層、並びに前記プラテンと前記固定砥粒物品の間に配置された 1 以上の任意の層のうち少なくとも 1 つが、空間調整された厚さ、空間調整された機械的特性、またはこれらの組合

せを有している請求項 1 に記載の装置。

【請求項 4】

- a) 第 1 の表面を含む基板を提供することと、
- b) 砥粒表面および対向表面を含む三次元固定砥粒物品を提供することと、
- c) 前記固定砥粒物品の前記対向表面を支持アセンブリと接触させることと、
- d) 前記基板の前記第 1 の表面を前記固定砥粒物品の前記砥粒表面と接触させることと

、
e) 垂直力を前記基板、前記固定砥粒物品および前記支持アセンブリに適用することにより、前記固定砥粒物品の前記砥粒表面と、前記基板の前記第 1 の表面との間に接触圧力を形成することと、

f) 前記基板の前記第 1 の表面と前記固定砥粒物品の前記砥粒表面との間に相対運動をもたらすことと

を含み、前記適用された垂直力および前記基板の前記第 1 の表面と前記砥粒表面の間の前記相対運動によって、前記固定砥粒物品の前記砥粒表面に侵食力を形成し、高侵食力の領域と低侵食力の領域を形成するように前記支持アセンブリを選択し、少なくとも前記高侵食力が前記固定砥粒物品を活性化させるのに十分であり、前記低侵食力が前記高侵食力より低い、三次元固定砥粒物品のインサイチュ活性化する方法。

【請求項 5】

前記基板の前記第 1 の表面と、前記固定砥粒物品の前記砥粒表面との間の界面に加工液を供給することを更に含み、L - プロリン、グリシン、アラニン、アルギニンおよびリシンを含む、請求項 4 に記載の方法。